

東京都立大学 機械システム工学科 清水 研究室

事業内容

～次世代PVDプロセスの開発支援～

大電力パルススパッタリング(HiPIMS)技術の導入に向けてトータルでサポート致します。

HiPIMS技術は、制御パラメータの限界に達している既存のPVDプロセスに対して、パルス技術を用いた柔軟なプロセス制御を実現し、これまで実現が難しかった薄膜成長や成膜プロセスの低温化を実現します。

技術支援内容

- HiPIMS技術導入に向けた既存技術との比較検証
- 最新のHiPIMSパルス技術の提案
- 対象膜種に応じたプロセス設計の提案

Ar雰囲気における
Wターゲットのプラズマ発光の比較

